



제 32회 한국반도체학술대회

The 32nd Korean Conference on Semiconductors

2025년 2월 12일(수)-14일(금) | 강원도 하이원리조트

Future Normal in Semiconductor

2025년 2월 13일(목), 10:55-12:40

Room D(에메랄드 I), 5층

A. Interconnect & Package 분과

016_[TD2-A] Emerging Interconnect 2

좌장: 안상훈 마스터(삼성전자), 이원준 교수(세종대학교)

TD2-A-1 10:55-11:10	광반도체 수명평가를 위한 고정밀 정선온도 세팅 기술 마병진, 정태희, 최성순, 김제민 한국전자기술연구원
TD2-A-2 11:10-11:25	Application of Physics-Informed Neural Networks (PINN) in Extreme Ultraviolet Lithography (EUVL) Process Simulation Sang-Kon Kim Hongik University
TD2-A-3 11:25-11:40	ALD Ru/ZnO의 공정 열처리 조건에 따른 박막 물성이 계면접착에너지에 미치는 영향 정대윤 ¹ , 김가희 ¹ , 김민진 ¹ , 손예슬 ² , Yuki Mori ^{2,3} , 김경현 ⁵ , 이주현 ⁵ , 변창우 ⁵ , 김수현 ^{2,4} , 박영배 ¹ ¹ 국립안동대학교 반도체·신소재공학과 청정에너지 소재기술연구센터, ² 울산과학기술원 반도체 소재부품 대학원, ³ Chemical Materials Development Department, TANAKA precious metals, ⁴ 울산과학기술원 신소재공학과, ⁵ 차세대융합기술연구원 경기도 반도체혁신센터
TD2-A-4 11:40-11:55	Ultra Low-k Properties of Atomic Layer Deposited Amorphous Boron Nitride for Futuristic Inter Metal Dielectric Inkyu Sohn ¹ , Taehoon Kim ² , and Hyungjun Kim ¹ ¹ School of Electrical and Electronic Engineering, Yonsei University, ² SAIT
TD2-A-5 11:55-12:10	A Theoretical Study of the Selective Silylation of Silicon Oxide with Dimethylaminotrimethylsilane Mi-Soo Kim, Khabib Khumaini, Hye-Lee Kim, and Won-Jun Lee Department of Nanotechnology and Advanced Materials Eng., Sejong University
초청 TD2-A-6 12:10-12:40	Advanced Amorphous Carbon Hardmasks for High-Density Semiconductor Patterning So-Yeon Lee ¹ , Hongik Kim ² , Ung-Gi Kim ² , Sungtae Kim ² , and Young-Chang Joo ² ¹ Kumoh National Institute of Technology, ² Seoul National University